

Valencia, 14 de octubre de 2016

El Comité Institucional de la Instalación Científica y Técnica Singular Micronanofabs se reúne en Valencia

- **Micronanofabs es una Instalación Científica y Técnica Singular Distribuida en tres ubicaciones distintas que sirve para investigar en el ámbito de la Microelectrónica, la Optoelectrónica y la Nanofotónica**
- **El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, ha acudido a la reunión junto con el coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán**

El Comité Institucional de la Instalación Científica y Técnica Singular (ICTS) Distribuida Micronanofabs se ha reunido hoy, 14 de octubre, en la Universitat Politècnica de València para valorar el plan estratégico, la memoria, el plan de actividades y los reglamentos de funcionamiento interno. Además, el Comité Institucional ha proporcionado directrices y encomendado acciones al Comité de Coordinación de Micronanofabs.

A la reunión han acudido: el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo; el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros; el subdirector general de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del Ministerio de Economía y Competividad, José Ignacio Doncel; y el vicepresidente del Consell Valencià de la Innovació de la Generalitat Valenciana, Andrés García Reche.

El término Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) se refiere a instalaciones, recursos o servicios de titularidad pública para desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad, así como para la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación. Son únicas o excepcionales en su género, con un coste de inversión, mantenimiento y operación muy elevado, y cuya importancia y carácter estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de I+D+i.

Micronanofabs es una ICTS Distribuida integrada por la Sala Blanca Integrada de Micro y Nano Fabricación del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC, localizada en Barcelona; la Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Opto-electrónicos de la

Universidad Politécnica de Madrid; y la Infraestructura de Micro y Nano Fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de València. Las tres infraestructuras están coordinadas para dar servicio a toda la comunidad científica en el ámbito de la Microelectrónica, Optoelectrónica y Nanofotónica. En su conjunto, ofrecen más de 2.000 metros cuadrados de salas blancas (clases 10-100-10.000) a la comunidad científica, a la industria y a laboratorios asociados.

La Infraestructura de Micro y Nano Fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de València está situada en el Campus de Vera y es la única ICTS Distribuida de la Comunidad Valenciana. Comenzó su actividad a finales del año 2009, ofreciendo desde entonces servicios de nanofabricación. La instalación ofrece servicios completos de prototipado rápido para grupos de investigación (básica y aplicada) y empresas tecnológicas, incluyendo desde la consultoría en diseños y soluciones completas basadas en fotónica integrada de silicio, hasta la fabricación parcial (procesos específicos) o completa de dispositivos fotónicos pasivos y activos en silicio. Además, se llevan a cabo los procesos de caracterización tanto física como óptica de los dispositivos o estructuras fabricadas.



Foto de grupo del Comité Institucional de Micronanofabs durante la reunión de hoy con el presidente del CSIC y el rector de la Universitat Politècnica de València en el medio

Más información:
Javier Martín López
Tel.: 96.362.27.57
Fax: 96.339.20.25

<http://www.dicv.csic.es>
jmartin@dicv.csic.es